

488696-2026 - Kilpailu

Irlanti – Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja) – LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots
OJ S 134/2026 15/07/2026

Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä - Ilmoituksen muutos

Tavarahankinnat

1. Ostaja

1.1. Ostaja

Virallinen nimi: Education Procurement Service (EPS)

Sähköposti: info@educationprocurementservice.ie

Ostajan oikeudellinen muoto: Julkisoikeudellinen yhteisö

Pääasiallinen toimiala: Yleinen julkishallinto

2. Menettely

2.1. Menettely

Ilmoituksen nimi: LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

Kuvaus: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Menettelyn tunnistus: a024c275-b92f-48d9-83b8-52aa370660c8

Menettelyn tyyppi: Avoin

Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

2.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 38000000 Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälasia)

2.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): South-East (IE052)

Maa: Irlanti

2.1.3. Arvo

Ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa: 3 300 000,00 EUR

2.1.4. Yleistä tietoa

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

2.1.5. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Osien enimmäismäärä, joiden osalta yksi tarjoaja voi jättää tarjouksia: 4

2.1.6. Poissulkemisperusteet

Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Ilmoituksen nimi: Plasma Etcher ,Silicon ,Dielectrics

Kuvaus: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Sisäinen tunniste: 1

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 38000000 Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälasia)

5.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): South-East (IE052)
Maa: Irlanti

5.1.3. Arvioitu kesto

Kesto: 48 Kuukaudet

5.1.5. Arvo

Ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

5.1.7. Strategiset hankinnat

Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: englanti

Kielet, joilla hankinta-asiakirjat (tai niiden osat) ovat epävirallisesti saatavilla: englanti

Lisätietojen pyytämisen määräaika: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Länsi-Euroopan kesäaika

Hankinta-asiakirjojen osoite: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: englanti

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen: Sallittu

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Länsi-Euroopan kesäaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 180 Päivät

Tietoa julkisesta avaamisesta:

Tarjousten avaamisen päivämäärä: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Länsi-Euroopan kesäaika

Paikka: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei vielä tiedossa

Sähköinen laskutus: Pakollinen

Tilaukset tehdään sähköisesti: ei

Maksut tehdään sähköisesti: ei

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:

Ei puitejärjestelyä

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: The High Court of Ireland

Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio: Education Procurement Service (EPS)

Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: The High Court of Ireland

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Education Procurement Service (EPS)

Tarjouksia käsittelevä organisaatio: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Osa: LOT-0002

Ilmoituksen nimi: Plasma Etcher ,Metals ,Piezoelectrics

Kuvaus: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Sisäinen tunniste: 2

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 38000000 Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälasia)

5.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): South-East (IE052)

Maa: Irlanti

5.1.3. Arvioitu kesto

Kesto: 48 Kuukaudet

5.1.5. Arvo

Ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

5.1.7. Strategiset hankinnat

Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: englanti

Kielet, joilla hankinta-asiakirjat (tai niiden osat) ovat epävirallisesti saatavilla: englanti

Lisätietojen pyytämisen määräaika: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika,

Länsi-Euroopan kesäaika

Hankinta-asiakirjojen osoite: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: englanti

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen: Sallittu

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Länsi-Euroopan kesäaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 180 Päivät

Tietoa julkisesta avaamisesta:

Tarjousten avaamisen päivämäärä: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Länsi-Euroopan kesäaika

Paikka: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei vielä tiedossa

Sähköinen laskutus: Pakollinen

Tilaukset tehdään sähköisesti: ei

Maksut tehdään sähköisesti: ei

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:

Ei puitejärjestelyä

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: The High Court of Ireland

Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio: Education Procurement Service (EPS)

Muutoksenhakumenettelyjen määrääjoista lisätietoja tarjoava organisaatio: The High Court of Ireland

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Education Procurement Service (EPS)

Tarjouksia käsittelevä organisaatio: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Osa: LOT-0003

Ilmoituksen nimi: Plasma Etcher ,Slow and Controllable Rate ,Atomic Layer Etch for Silicon , Dielectrics

Kuvaus: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Sisäinen tunniste: 3

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 38000000 Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja)

5.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): South-East (IE052)

Maa: Irlanti

5.1.3. Arvioitu kesto

Kesto: 48 Kuukaudet

5.1.5. Arvo

Ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

5.1.7. Strategiset hankinnat

Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: englanti

Kielet, joilla hankinta-asiakirjat (tai niiden osat) ovat epävirallisesti saatavilla: englanti

Lisätietojen pyytämisen määräaika: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Länsi-Euroopan kesäaika

Hankinta-asiakirjojen osoite: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Hankinnan ehdot**Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:**

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: englanti

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen: Sallittu

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Länsi-Euroopan kesäaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 180 Päivät

Tietoa julkisesta avaamisesta:

Tarjousten avaamisen päivämäärä: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Länsi-Euroopan kesäaika

Paikka: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei vielä tiedossa

Sähköinen laskutus: Pakollinen

Tilaukset tehdään sähköisesti: ei

Maksut tehdään sähköisesti: ei

5.1.15. Menetelmät**Puitejärjestely:**

Ei puitejärjestelyä

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: The High Court of Ireland

Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio: Education Procurement Service (EPS)

Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: The High Court of Ireland

5.1. Osa: LOT-0004

Ilmoituksen nimi: Plasma Deposition ,PECVD

Kuvaus: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Sisäinen tunniste: 4

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 38000000 Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälasia)

5.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): South-East (IE052)

Maa: Irlanti

5.1.3. Arvioitu kesto

Kesto: 48 Kuukaudet

5.1.5. Arvo

Ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

5.1.7. Strategiset hankinnat

Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: englanti

Kielet, joilla hankinta-asiakirjat (tai niiden osat) ovat epävirallisesti saatavilla: englanti

Lisätietojen pyytämisen määräaika: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Länsi-Euroopan kesäaika

Hankinta-asiakirjojen osoite: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: englanti

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen: Sallittu

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Länsi-Euroopan kesäaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 180 Päivät

Tietoa julkisesta avaamisesta:

Tarjousten avaamisen päivämäärä: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Länsi-Euroopan kesäaika

Paikka: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei vielä tiedossa

Sähköinen laskutus: Pakollinen

Tilaukset tehdään sähköisesti: ei

Maksut tehdään sähköisesti: ei

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:

Ei puitejärjestelyä

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: The High Court of Ireland

Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio: Education Procurement Service (EPS)

Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: The High Court of Ireland

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Education Procurement Service (EPS)

Tarjouksia käsittelevä organisaatio: Education Procurement Service (EPS)

8. Organisaatiot

8.1. ORG-0001

Virallinen nimi: Education Procurement Service (EPS)
Rekisterinumero: IE 6609370 G
Postiosoite: Castletroy Limerick
Postitoimipaikka: Limerick
Postinumero: V94 DK53
Maaryhmittely (NUTS): Mid-West (IE051)
Maa: Irlanti
Sähköposti: info@educationprocurementservice.ie
Puhelin: 000
Internetosoite: <https://www.educationprocurementservice.ie/>
Hankkijaprofiili: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Tämän organisaation roolit:

Ostaja
Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio
Tarjouksia käsittelevä organisaatio

8.1. ORG-0002

Virallinen nimi: The High Court of Ireland
Rekisterinumero: The High Court of Ireland
Yksikkö: The High Court of Ireland
Postiosoite: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7
Postitoimipaikka: Dublin
Postinumero: D07 WDX8
Maaryhmittely (NUTS): Dublin (IE061)
Maa: Irlanti
Sähköposti: HighCourtCentralOffice@courts.ie
Puhelin: +353 1 8886000

Tämän organisaation roolit:

Muutoksenhakuelin
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio

8.1. ORG-0003

Virallinen nimi: European Dynamics S.A.
Rekisterinumero: 002024901000
Yksikkö: European Dynamics S.A.
Postitoimipaikka: Athens
Postinumero: 15125
Maaryhmittely (NUTS): Βόρειος Τομέας Αθηνών (EL301)
Maa: Kreikka
Sähköposti: eproc-esender@eurodyn.com
Puhelin: +30 2108094500

Tämän organisaation roolit:

TED eSender

10. Muutos

Muutettavan ilmoituksen edellinen versio
:
46fee6a2-f409-4cd6-80db-618a50fcc925-01

Muutoksen pääasiallinen syy

:

Ajantasaiset tiedot

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: 7a2067c1-5ebe-49f4-b53b-0f9595ac5fa3 - 02

Lomakkeen tyyppi: Kilpailu

Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä

Ilmoituksen alatyyppe: 16

Ilmoituksen lähetyspäivä: 13/07/2026 16:03:29 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Länsi-Euroopan kesäaika

Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: englanti

Ilmoituksen julkaisunumero: 488696-2026

EUVL S -lehden numero: 134/2026

Julkaisupäivä: 15/07/2026